(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平5-238988

(43)公開日 平成5年(1993)9月17日

(51) Int.Cl.*

識別記号

FΙ

技确表示箇所

C 0 7 C 69/653

67/00 67/08 9279 – 4H

庁内整理番号

審査請求 未請求 請求項の数3(全 6 頁)

(21)出願番号 -

特顯平4-78498

(71)出願人 000002060

信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

(22)出顧日

平成4年(1992)2月28日

(72) 発明者 猪俣 博

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料

技術研究所内

(72)発明者 樽見 康郎

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 島地ル公子本はさ合社3-11コーン電子は5

信越化学工業株式会社シリコーン電子材料

技術研究所内

(74)代理人 弁理士 岩見谷 周志

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 含フッ素有機化合物及びその製造方法

(57) 【要約】

【構成】 式(1):

(化1]

$$CH_{*} = CH + CH_{*} + . C - 0 - C - C = CH_{*}$$

$$CH_{*} = CH + CH_{*} + . C - 0 - C - C = CH_{*}$$

$$CF_{*} = R$$
(1)

(式中、Rは水素原子又はメチル基であり、nは0又は1の整数である。)で表される含フッ素有機化合物。含フッ素不飽和アルコールとアクリル酸又はメタクリル酸とを脱水剤の存在下で反応させることを特徴とする前記含フッ素有機化合物の製造方法、及び含フッ素不飽和アルコールと有機リチウムとを反応させ、リチウムアルコキシドとし、該リチウムアルコキシドと塩化アクリル又は塩化メタクリルとを反応させることを特徴とする前記含フッ素有機化合物の製造方法。

【効果】 様々な化合物と反応し、それらの化合物にトリフルオロメチル基を導入することができ、それらの化合物の撥水性、耐湿性、その他のフッ素材料への適合性等を向上させることができると期待される。

per English abstract

【特許請求の範囲】

【請求項1】 式(1):

(式中、Rは水素原子又はメチル基であり、nは0又は 1の整数である。) で安される含フッ素有機化合物。

【鯖求項2】 式(2):

【化2】

$$CH_2 = CH + CH_2 + CH_3 + C - OH$$
(2)
$$CH_2 = CH + CH_3 + CH_3 + CH_3$$

$$CH_3 = CH_4 + CH_3 + CH_3 + CH_3$$

$$CH_4 = CH_4 + CH_3 + CH_3 + CH_3$$

(式中、nは0又は1の整数である。) で表される含フ ッ素不飽和アルコールと、アクリル酸又はメタクリル酸 とを脱水剤の存在下で反応させることを特徴とする請求 項1に記載の含フッ素有機化合物の製造方法。

【請求項3】 上記式(2) で表される化合物と、有機り チウムとを反応させ、リチウムアルコキシドとし、次に 前記リチウムアルコキシドと塩化アクリル又は塩化メタ クリルとを反応させることを特徴とする請求項1に記載 の含フッ素有機化合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、一分子中にアクリロキ シル基又はメタクリロキシル基、ピニル基、及びトリフ ルオロメチル基を有する含フッ森有機化合物に関する。 ※30

CF: 0 $CH_2 = CH + CH_2 + CH_2 + CH_2$ CF.

(式中、Rは水素原子又はメチル基であり、nは0又は 1の整数である。) で表される含フッ素有機化合物を提 供する。また、本発明は、式(2):

(化4)

$$CF_{2} = CH + CH_{2} + CH_{3} + C - OH$$

$$CF_{2}$$

$$CF_{3}$$

$$C - OH$$

$$CF_{3}$$

(式中、nは0又は1の整数である。) で表される含フ ッ素不飽和アルコールと、アクリル酸又はメタクリル酸 とを脱水剤の存在下で反応させることを特徴とする上記 式(1) で表される含フッ素有機化合物の製造方法を提供 する。更に、本発明は、上記式(2) で表される化合物 と、有機リチウムとを反応させ、リチウムアルコキシド 50 コールは、従来から知られている化合物であり、式(3):

%[0002]

【従来の技術】従来から、一分子中にアクリロキシル基 10 又はメタクリロキシル基及びピニル基を有するアリルア クリレート又はアリルメタクリレートが知られており、 それらは単独で重合することにより高分子体を形成した り、分子内に炭素ー炭素の二重結合を有する化合物と共 重合して高分子体を形成することから工業的に幅広く利 用されている。また、分子内にアクリル基、メタクリル 基を有することからアクリル樹脂の架橋剤として使用さ れたり、更に、各種シラン類を付加させることにより、 シランカップリング剤として使用されている。然しなが ら、一分子中にアクリロキシル基又はメタクリロキシル 20 基、ビニル基及びトリフルオロメチル基を有する含フッ 案有機化合物は未だ知られていない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は、一分子中にアクリロキシル基又はメタクリロキシル 基、ピニル基及びトリフルオロメチル基を有する新規な 含フッ業有機化合物を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、式(1): [48.3]

(1)

とし、次に前記リチウムアルコキシドと塩化アクリル又 は塩化メタクリルとを反応させることを特徴とする上記 式(1) で表される含フッ素有機化合物の製造方法を提供 する。本発明の含フッ素有機化合物は、一方の末端にア 40 クリロキシル基又はメタクリロキシル基を有し、他方の 末端にピニル基を有し、更にトリフルオロメチル基-CP 」基を有する。

【0005】本発明の含フッ素有機化合物は、上配式 (2) で表される含フッ素不飽和アルコールと、アクリル 酸又はメタクリル酸とを脱水剤の存在下、通常、-30℃ ~30℃、好ましくは~5℃~10℃で、通常、0~120 分 間程度、好ましくは0~30分間程度反応させることによ り製造することができる。

【0006】上記式(2) で安される含フッ案不飽和アル

(化5)

で表される 1,1,1-トリフルオロー2-トリフルオロメ チルー3-プテン-2-オール又は式(4): (化6)

$$CF_{3} = CH - CH_{3} - C - OH$$

$$CH_{3} = CH - CH_{3} - C - OH$$

$$CF_{3}$$

で表される 1,1,1ートリフルオロー2ートリフルオロメ チルー4ーペンテン-2ーオールである。これらは、通 常行われている方法により製造することができる。例え ば、所聞グリニャール反応によって製造することがで き、式(3) で表されるアルコールは、ピニルマグネシウ ル等の溶媒中で反応させた後、加水分解することにより 製造することができる。また、式(4) で表されるアルコ ールは、アリルマグネシウムプロマイドとヘキサフルオ ロアセトンとを無水エーテル等の溶媒中で反応させた 後、加水分解することにより製造することができる。更 に、式(4) で表されるアルコールは、プロピレンとヘキ サフルオロアセトンとを、例えば、40~50kg/cm の圧 カ下、温度 100~150 ℃で5~18時間程度反応させるこ とにより製造することもできる。

[0007] また、上記脱水剤としては、濃硫酸、発煙 30 MS 硫酸、五酸化二リン等が挙げられる。この中で好ましい ものは、発煙硫酸である。発煙硫酸を使用する場合、発 煙硫酸中の三酸化イオウSO。の濃度は、5~60重量%が 好ましく、更に、20~40重量%が好ましい。

【0008】また、本発明の含フッ素有機化合物は、上 記式(3) 又は(4) で表される含フッ素不飽和アルコール と、有機リチウムとをエーテル系有機溶媒中、通常、一 78~20℃、好ましくは、-20~0℃で、通常、0~120 分間程度、好ましくは0~30分間程度反応させてリチウ ムアルコキシドとした後、そのリチウムアルコキシド 40 と、塩化アクリル又は塩化メタクリルとを、通常、-20 ~80℃、好ましくは、0~70℃で、1~5時間程度反応 させることにより、製造することができる。

【0009】上配有機リチウムとしては、例えば、メチ ルリチウム、nープチルリチウム、1ープチルリチウ ム、sープチルリチウム、tープチルリチウム、フェニ ルリチウム等が挙げられる。この中で好ましいものは、 メチルリチウム、n-プチルリチウムである。

【0010】エーテル系有機溶媒としては、例えば、ジ エチルエーテル、ジーn-プロピルエーテル、ジーn-50

ブチルエーテル、テトラヒドロフラン等が挙げられる。 この中で好ましいものは、ジエチルエーテル、テトラヒ ドロフランである。

[0011]

【実施例】

実施例1

200ml 三ロフラスコに、 1,1,1-トリフルオロー2-ト リフルオロメチルー3-プテン-2-オール49.0g(0. 25モル) 及びメタクリル酸22.1g (0.25モル) を入れ 10 て、フラスコ上部に冷却管を付けた。そのフラスコを氷 浴中に入れてフラスコ内の温度を3~10℃に保ちなが ら、遠流及びマグネティックスターラーによる提幹下 に、発煙硫酸 (SOs : 30重量%, 0.19モル) を少量づつ 滴下した。上記反応混合物にクロロホルム及び水を加え て溶媒抽出を行い、クロロホルム相を回収した。そのク ロロホルム相に無水硫酸ナトリウムを添加して乾燥した 後、減圧蒸留して、57~58℃/23torrにおいて11.4gの 生成物を得た(収率16.6%)。この化合物について、1 H-NMR、赤外線吸収スペクトル、元素分析及びMS ムプロマイドとヘキサフルオロアセトンとを無水エーテ 20 の測定を行った。その結果を以下に示す。この結果か ら、得られた化合物は式:

(化7)

で安される化合物であると認められる。

[0012] ① 1H-NMR;溶媒 CC14 、内部原準T

[化8]

6. 1ppm (s, 1E, (化91

図1に示す。

$$c = c$$

【0013】②赤外線吸収スペクトル;液膜法

③元素分析; C. H. O. F. として COD H(X) F(X) 計算位 41.24 3.08 43.48 40.89 43.01 測定值 3, 33

ØMS

262 (M+) , 177, 157, 137, 69 (· CF;)

[0014] 実施例2

1000㎡三口フラスコに、 1,1,1-トリフルオロー2ート リフルオロメチル-3-プテン-2-オール50.0g(2 5.8ミリモル)とテトラヒドロフラン 350mlを入れて、 フラスコ上部に冷却管を付けた。そのフラスコを氷浴中 に入れてフラスコ内の温度を2~15℃に保ちながら、還 流及びマグネティックスターラーによる攪弁下に、n-ブチルリチウム/n-ヘキサン溶液(n-ブチルリチウ ム:15重量%) を 121.1g (n-プチルリチウム:2 8.3ミリモル)を滴下した。滴下終了後、氷浴を除去し て、22~28℃で提拌しながら、テトラヒドロフラン 250 mlに塩化メタクリル29.6g (28.3ミリモル) を溶解した 溶液を滴下した。滴下終了後、更に 1.3時間、60~64℃ で加熱還流した。上記反応混合物を水洗した後、有機溶 20 6.1ppm (d. 1E. 棋相を回収した。その有機溶媒相に無水硫酸ナトリウム を添加して乾燥した後、減圧蒸留して、58℃/23torrに おいて38.8gの生成物を得た(収率57.4%)。この化合 物について、実施例1と同様に 1H-NMR、赤外線吸 収スペクトル、元素分析及びMSの測定を行ったとこ ろ、実施例 1 と同じ化合物であることが確認された。

[0015] 実施例3

5000ml 三ロフラスコに、 1,1,1-トリフルオロー2-ト リフルオロメチルー4ーペンテンー2ーオールを 294.1 g(1.41モル)とテトラヒドロフラン1500回を入れて、 フラスコ上部に冷却管を付けた。そのフラスコを氷浴中 に入れてフラスコ内の温度を3~13℃に保ちながら、還 流及びマグネディックスターラーによる攪弁下に、n-プチルリチウム/n-ヘキサン溶液(n-プチルリチウ ム:15重量%) を 682.0g (n-プチルリチウム:1.60 モル)を摘下した。滴下終了後、5~15℃で提拌しなが ら、テトラヒドロフラン1500mlに塩化メタクリル 166.2 g (1.59モル)を溶解した溶液を滴下した。滴下終了 後、氷浴を除去して、更に40分間、40~58℃で加熱し た。その有機溶媒相に無水硫酸ナトリウムを添加して乾 燥した後、減圧蒸留して、61℃/27torrにおいて 267.8 g (1.11モル) の生成物を得た(収率69%)。この化合 物について、「H-NMR、赤外線吸収スペクトル、元 素分析及びMSの測定を行った。その結果を以下に示 す。この結果から、得られた化合物は式:

(化101

で表される化合物であると認められる。

【0016】① 1H-NMR:溶媒 CCl. 、内部標準T MS

1.9ppm (d, 3H, -CH₃) 10 3. 2ppm $(d, 2H, -CH_2 -)$ 5. 2ppm (m, 3H, -CH=CH₂)5.6ppm (m. 1H.

(化11)

$$C = C$$

(化12)

【0017】②赤外線吸収スペクトル;液膜法 図2に示す。

③元素分析; Cie Hie Oz Fe として C (%) H(%) F (%)

計算値 43.49 3.65 41.27 測定値 43.15 3.88 41.09

4DM S

276 (M°), 231, 211, 190, 171, 145, 121, 101, 8 6, 69 (· CF₃)

[0018]

【発明の効果】本発明の含フッ素有機化合物は、分子内 にトリフルオロメチル基ーCP:を有しており、更に、反 た。上記反応混合物を水洗した後、有機溶媒相を回収し 40 応性に富むアクリロキシル基又はメタクリロキシル基を 一方の末端に有し、他方の末端に前配同様反応性に奮む ピニル基を有する。従って、様々な化合物と反応して、 それらの化合物にトリフルオロメチル基を導入すること ができ、それら化合物の撥水性、耐湿性、その他のフッ 索材料への適合性等を向上させることができると期待さ れる。本発明の含フッ素有機化合物は、例えば、カーボ ンファンクショナルシラン等を製造する場合の中間原料 として有用であると期待される。

【図面の簡単な説明】

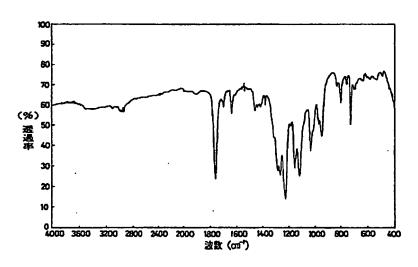
50 【図1】実施例1で合成された含フッ素有機化合物の赤

外線吸収スペクトルを示すグラフである。

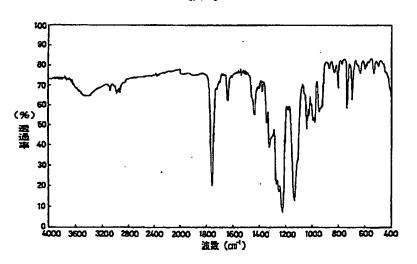
外線吸収スペクトルを示すグラフである。

【図2】実施例3で合成された含フッ素有機化合物の赤

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 山口 博正

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内 (72)発明者 福田 健一

群馬県確氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内

特開平5-238988

(72)発明者 宗鄰 一俊

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内 PAT-NO:

JP405238988A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05238988 A

TITLE:

FLUORINE-CONTAINING ORGANIC COMPOUND AND ITS

PRODUCTION

PUBN-DATE:

September 17, 1993

INVENTOR-INFORMATION:

NAME INOMATA, HIROSHI TARUMI, YASURO YAMAGUCHI, HIROMASA FUKUDA, KENICHI MUNESAWA, KAZUTOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHIN ETSU CHEM CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP04078498

APPL-DATE:

February 28, 1992

INT-CL (IPC): C07C069/653, C07C067/00, C07C067/08

US-CL-CURRENT: 560/223

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the subject new compound useful for improving water repellency, etc., of compounds, hopeful as an intermediate raw material for carbon functional silanes by introducing trifluoromethyl to various compounds.

CONSTITUTION: A compound of formula I (R is H or methyl; (n) is 0 or 1)

1/19/06, EAST Version: 2.0.1.4

such

as the compound of formula II. This compound is obtained by reacting a fluorine-containing unsaturated alcohol of formula III with (meth)acrylic acid in the presence of a dehydrating agent (preferably fuming sulfuric acid) preferably at -5 to 10°C for 0-30 minutes. For example, 1,1,1-trifluoro-2-trifluoromethyl-3-buten-2-ol may be cited as the compound of formula III and is obtained by reacting vinylmagnesium bromide with hexafluoroacetone in a solvent

such as an anhydrous ether and hydrolyzing the reactional product.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio